

2018年11月28日

AGC、EUV露光用フォトマスクブランクス供給体制をさらに増強

AGC（AGC株式会社、本社：東京、社長：島村琢哉）は、グループ会社・AGCエレクトロニクス（本社：福島県郡山市、社長：佐藤弘昌）において、EUV露光用フォトマスクブランクス（以下、EUVマスクブランクス）の供給体制増強を、今年2月5日発表分に加えて、追加実施することを決定しました。今回の追加実施により、AGCグループのEUVマスクブランクス生産能力は2020年に現在の約3倍になります。

あらゆるモノがインターネットに接続するIoTの時代を迎え、電子機器が高機能・小型化し、半導体チップには計算処理の高速化やデータの大容量化、高集積化が求められています。これに対応するためには半導体チップの回路パターンを微細にする必要がありますが、現行の光リソグラフィ技術^{※1}では、“7nm世代”と呼ばれる微細なパターン形成は理論上難しく、それに代わる技術として最有力とされているのがEUV^{※2}露光技術です。



EUV マスクブランクス

AGCは、EUV露光技術で用いられるフォトマスクブランクスの研究開発を2003年に開始しました。自社で保有するガラス材料技術、ガラス加工技術、コーティング技術などを統合し、AGCは「ガラス材料」から「膜材料」までを一貫して手掛けることができる、世界で唯一のEUVマスクブランクスメーカーです。

当社は今後主流になるEUV露光技術の拡大を見据え、グループ会社であるAGCエレクトロニクス社において、EUVマスクブランクス供給体制を増強することを決定しました。

AGCグループは、経営方針 **AGC plus** の下、エレクトロニクス事業を戦略事業のひとつと位置付けています。今後大きな需要の伸びが見込まれるEUVマスクブランクス事業に対し積極的な設備投資を実施し、半導体産業の発展に貢献していきます。

以上

◎本件に関するお問い合わせ先：

AGC株式会社 広報・IR部長 玉城 和美

（担当：太田 TEL: 03-3218-5603 E-mail: info-pr@agc.com）

*個人情報は当社プライバシーポリシーに従ってお取扱いをさせていただきます。

—注釈—

- ※ 1 KrF（フッ化クリプトン）や ArF（フッ化アルゴン）光源を用いて、LSI 回路パターンをシリコンウェハー等に転写するプロセスのこと。
- ※ 2 波長 13.5nm の極端紫外線のこと。

—ご参考—

■ A G Cエレクトロニクス社について

社名	A G Cエレクトロニクス株式会社
資本金	300 百万円
代表	佐藤 弘昌
本社所在地	福島県郡山市
従業員数	約 600 名（2017 年 12 月末現在）
主な事業内容	半導体関連部材事業、光デバイス事業など

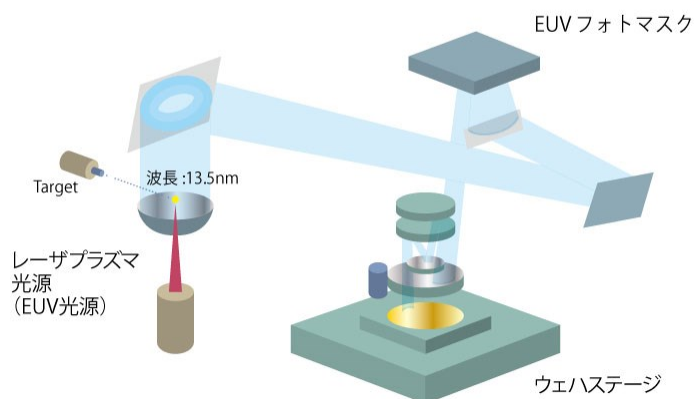
■ EUV マスクブランクスについて

EUV マスクブランクスは、低膨張ガラス基板の表面に複数の組成から成る膜を積層したものです。EUV マスクブランクの表面に半導体チップの回路原版を形成したものが EUV フォトマスクであり、その回路をシリコンウェハー上に転写して半導体チップを形成します。回路の微細化に伴い、EUV マスクブランクスに対する

- ・非常に小さなサイズの欠陥を限りなくゼロに近づけること
- ・非常に高い平坦度であること

といった要求水準は、更に高くなっています。

EUV 露光装置の概観図



◎ 本件に関するお問い合わせ先：

A G C株式会社 広報・IR 部長 玉城 和美

(担当：太田 TEL: 03-3218-5603 E-mail: info-pr@agc.com)

*個人情報は当社プライバシーポリシーに従ってお取扱いをさせていただきます。